

オープニング ; 界面ナノ電子化学研究会の意義

Opening; Positioning of INE activity

㈱SCREEN セミコンダクターソリューションズ 荒木浩之

SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd. Hiroyuki Araki

E-mail: h.araki@prp.screen.co.jp

【はじめに】 界面ナノ電子化学の活動は新領域の頃を含め 10 年目を迎えようとしている。講演会セッションの質疑応答以上に深い議論がしたいと始めた研究会は、このシンポジウムや、セミナー、ワーキンググループと活動の幅を広げてきた。そして、暗黙知の共鳴場^[1]を形成しようというスタート時の思い^[2]は関係者の間で^[3]現在も受け継がれてきた。これは半導体製造プロセスにおける洗浄技術の位置付け^[4]が関係しているのかもしれない。節目のシンポジウムで、これまでの活動を振り返るとともに、今後の展開を考えてみたい。

【活動内容】 界面ナノ電子化学研究会では双方向の「場」を形成するよう意識して、これまで各種イベントを開催している。シンポジウム (講演会) : 50~100 人規模で一方向になる部分もあるが、必ず懇親会を開催し交流を図る「場」を作っている。セミナー : 昨年 12 月に開催したナノインタラクティブセミナーは 30 名程の人数で、講演者-参加者、学術-産業、の積極的な双方向のディスカッションが、その名の通り行うことができた。ワーキンググループ : 10~20 名で開催している。コアなテーマを選び、最近ではファシリテータを中心にワークショップ形式を採用し、現象の理論的解明を行うべく活動を行っている。

【今後の展開】 産業界関係者が 9 割以上を占める INE において、前述のような理論的解明を推進する動きが活発になってきた。暗黙知で終わらせることなく、知を創造し、それを展開する「場」が必要であると認識できる。産業界に見られなくなった研究所の役割、アイデアの源泉を期待される部分もあり、「暗黙知の共鳴場」への期待にどのように応えていくか、INE に問われているものはあまりにも大きい。

【謝辞】 本研究会の立ち上げに多大なるご尽力をいただきました故青木秀充先生に深く感謝いたします。

【参考文献】 [1] 山口栄一, 『イノベーション 破壊と共鳴』, NTT 出版, 2006.3.3 [2] 洗浄関係者ミーティングカサロス案内状, 2006.3 [3] 矢野大作, “オープニング シンポジウム開催にあたって” シンポジウム(第 16 回講演会)「界面ナノ電子化学: 半導体ウェットプロセスの最前線」2014.9.17 [4] 湯之上隆, “洗浄技術の時代がやってきた” 第 7 回 界面ナノ電子化学研究会 「ウェット・洗浄技術を界面ナノ電子化学へ」2011.3.19